

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 7 月 20 日 (2006.7.20)

【公表番号】特表 2002-519829 (P2002-519829A)

【公表日】平成 14 年 7 月 2 日 (2002.7.2)

【出願番号】特願 2000-557480 (P2000-557480)

【国際特許分類】

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

C 0 3 C 17/245 (2006.01)

C 0 9 C 3/06 (2006.01)

C 2 3 C 14/00 (2006.01)

H 0 1 B 1/00 (2006.01)

C 0 8 K 9/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 B 13/00 5 0 1 Z

C 0 3 C 17/245 A

C 0 9 C 3/06

C 2 3 C 14/00 A

H 0 1 B 1/00 D

H 0 1 B 1/00 H

C 0 8 K 9/02

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 5 月 25 日 (2006.5.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (a) 無機材料および高分子材料からなる群より選択される材料を各粒子がそれぞれ含んでいる、複数のコア粒子を提供する段階と、

(b) 導電性金属酸化物を含む導電性被膜を、物理蒸着によって、導電性酸化物被膜が各コア粒子に接着されるように各粒子に付着させ、 E_w^* の値を有する複数の被覆粒子を含む組成物を生成する段階と、

(c) 前記組成物を酸素を含む雰囲気中で任意に加熱して、前記被覆粒子の E_w^* 値を減少させる段階と、

を備える方法において、

前記被覆粒子は、体積抵抗率が約 0.1 cm より大きく約 1000 cm 未満であり

、

次の (I) および (II)、

(I) 前記段階 (b) の後の被覆粒子が E_w^* 値約 50 未満を有する、

(II) 含まれるとすれば、前記段階 (c) の後の被覆粒子が E_w^* 値約 50 未満を有する、

の少なくとも一方に該当する方法。

【請求項 2】 前記コア粒子が、ガラス、セラミック、鉱物、およびそれらの混合物からなる群より選択される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 前記コア粒子は、総空隙率がセラミック楕円体の総体積の約 10 ~ 約 98 パーセントとなるように空隙を含むセラミック楕円体、総空隙率がガラス楕円体の体

積の約 10 ～ 約 98 パーセントとなるように空隙を含むガラス楕円体、およびそれらの混合物からなる群より選択される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】 前記コア粒子の平均 B E T 表面積が約 $20 \text{ m}^2 / \text{グラム}$ 未満である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】 前記 (b) の被膜が酸化インジウムスズを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】 請求項 1 の方法により作製される被覆粒子。